# Liquid crystal display device and method for manufacturing the same

Publication number: TW493096B

Publication date:

2002-07-01 **Inventor:** 

US6010384 (A1)

Also published as:

NISHINO TETSUYA (JP); MORIMOTO HIROKAZU (JP);

TANAKA TAKAOMI (JP)

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO (JP)

- International: **Classification:** 

Applicant:

C03B33/07; G02F1/1333; C03B33/00; G02F1/13; (IPC1-7): G02F1/133

C03B33/07; G02F1/1333K - European:

Application number: TW19980113274 19980812

Priority number(s): JP19970234079 19970829; JP19970234080 19970829

Report a data error here

# Abstract of TW493096B

The present invention is to contact the scribe lines formed by the mother glass 100M for the array substrate with the spacers 210 in a linear, almost equal pitch and island configuration on the mother glass 200M on the opposite substrate. Thus, when applying an uniform impact on the mother glass for the opposite substrate right above the scribe lines, the impact will be focused on the spacers 210. The impact conducting the dicing on the mother glass for the array substrate without causing any unqualified dicing formed with the scribe lines will be progressed in a direction vertical to the opposite glass surface, and will be transmitted to the mother glass for the array substrate through the spacers, so that the cracks

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

2008/06/20

### 附件 2 第 87113274 號專利申請案 中文說明書修正頁

民國89年7月 修正

申請日	期	27	ģę.	8	R	12	FI
案	號		- 88 - 31	227	3		
類	別	60	> 7-	_	1/3	3	

= 8 1 13 C4

493096

(以上各欄由本局填註) 493096

	A A	· 明 專 利 説 明 書	
一、發明 一、新型名稱	中文	液晶顯示裝置及其製造方法	
	英文	Liquid crystal display device and method f manufacturing the same	or
	姓名	(1) 西野哲哉 ② 森本浩和 (3) 田中孝臣	
- 	國 籍	(1) 日本	τ .
· 發明人		(1) 日本國兵庫縣姬路市網干區北新在家八六--	
	住、居所	② 日本國兵庫縣揖保郡揖保川町黍田五六-三 B-二〇一	
		(3) 日本國兵庫縣揖保郡太子町鵤三〇〇	
	姓 名 (名稱)	(1) 東芝股份有限公司 株式会社東芝	
i.	國 籍	(1) 日本	
、申請人	住、居所	(1) 日本國神奈川縣川崎市幸區堀川町七二番地	
	(事務所)		
	代表人姓 名		
	1 ~ ~	(1) 西室泰三	

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

申請日期 87 年 8 月 12 日 A4 案 號 87113274 C4 別 類 (以上各欄由本局填註) 明 書 利 説 明 中 文 液晶顯示裝置及其製造方法 發明 新型 名稱 英 文 (1) 西野哲哉 名 姓 森本浩和 田中孝臣 2 (3) 日本 日本 (2) (1) 日本 國 籍 日本國兵庫縣姫路市網干區北新在家八六一一 發明 創作 住、居所 日本國兵庫縣揖保郡揖保川町黍田五六-三 B-二〇一 0 日本國兵庫縣揖保郡太子町鵤三〇〇 東芝股份有限公司 名 株式会社東芝 (名稱) 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 籍 (1) 日本 日本國神奈川縣川崎市幸區堀川町七二番地 住、居所 三、申請人 (事務所) 代表人 姓 名 (1) 西室泰三

装

T

線

本紙張尺度適用中國國家標準 (CNS) A4規格 (210×297公釐)

0年1731,产迁

請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

)

四、中文發明摘要(發明之名稱

液晶顯示裝置及其製造方法

於陣列基板用母玻璃100M所形成畫線上、接觸有在對向基板用母玻璃200M以直線且略等間隔,呈島狀設置之間隔物210。因此,當從位於畫線正上方位置之對向基板用母玻璃側施加均一之衝擊時,衝擊集中於間隔物 2 1 0 ,該衝擊將介由間隔物傳至陣列基板用母玻璃側。如此則形成有畫線之裂痕可以相對玻璃面呈略垂直之方向進行,在不致產生切割不良狀態下,對陣列基板用母玻璃進行切割。

英文發明摘要(發明之名稱》

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

有關經生物已寄存於: 寄存號碼:	本案已向: 國(地區 日本 日本	E) 申請專利,申請日期 1997 年 8 月 29 1997 年 8 月 29	,□有 □無主張優先權 ☑有主張優先權 ☑有主張優先權	(
				先閱讀背面之注意事項再填容
	有關微生物已寄存		,寄存號碼:	(本頁各欄)

本纸张尺度通用中國國家標準 (CNS) A4規格 (210×297公釐) - 3 -

A7 B7 補充

### 五、發明説明(1)

本發明係關於液晶顯示裝置及其製造方法,特別關於用來切斷構成液晶顯示裝置之玻璃基板用的切割方法。

習知技術

一般,液晶顯示裝置係如下製造。

亦即,於各具電極之2片玻璃基板之任一側之全面設間隔物。該間隔物係利用於2片基板貼合時保持2基板間之間隔物,例如藉光蝕刻製程形成固定於如類程。間隔物,係於後製程塗布之密封材所包圍領域即顯示領域內配置之密度均一地配置。之後,的過過領域以較顯示領域內容度均一地配置。之後,的便密封材後,將2片基板貼合,使密封材硬化。之後,將2片玻璃基板切成所要大小,於兩基板間對入液晶材料以形成液晶顯示裝置。

玻璃基板切割時,可利用線鋸法(dicing)或壓電法(piezo),其中最廣泛利用者爲畫線法(scribe)。畫線法係如下對玻璃基板進行切割。

亦即,藉銳利之鑽石等硬質構件形成之畫線器(scriber),於玻璃基板表面畫出特定之切割線,沿切割線形成裂痕。由形成裂痕之面之背側施加衝擊使產生裂痕,以切斷玻璃基板。

對液晶顯示裝置之玻璃基板作切割時,於基板表面畫出切割線,沿切割線形成裂痕(即畫線)。之後,藉由稱為衝腦器(Break bar)之橡膠製棒狀構件,從玻璃基板背

### 五、發明説明(2)

側沿畫線施加均一之衝擊,以使玻璃基板沿畫線衝斷。依 此可將玻璃基板切成所要大小。

於液晶顯示裝置之製程中,介由間隔物貼合之第 1 玻璃基板及第 2 玻璃基板,係如下被切割。又,間隔物係固定形成於第 2 玻璃基板上之特定位置。

亦即,於第1玻璃基板表面形成畫線。從對向配置之第2玻璃基板表面側藉衝斷器沿畫線均一地施加衝擊力,以切斷第1玻璃基板。

此時,2片玻璃基板之間,僅存在間隔物,衝斷器施加之衝擊,係介由間隔物由第2玻璃基板傳至第1基板。因此,衝擊集中於間隔物,畫線器所形成之裂痕,將因施加之衝擊而有朝向間隔物之傾向。即,切割絲之玻璃基板之切割面之形狀,及間隔物之位置關係,具有極密切之關係。

於周邊領域,間隔物以較遠離畫線之位置爲疏之密度配,故裂痕有朝向間隔物進行之傾向。因此,玻璃基板之切割面相對於基板主面不呈略垂直,而形成銳利之斷面形成。因此,上述間隔物之配置構造,產生容易發生切割不良,良品率低等問題。另外,此種切割不良,於後續之製程中易於產生玻璃缺損。此種玻璃缺損成爲玻璃碎片,進入兩玻璃基板之間,或偏光板與玻璃基板之間等,而引起所謂碎片不良,及良品率降低之原因。

又,衝擊器對玻璃基板施加衝擊之位置,即衝擊位置 ,一般相對於畫線偏離 1 mm程度之可能性高。衝擊器相

### 五、發明説明(3)

對畫線呈偏離狀態對玻璃基板施加衝擊時,該衝擊有可能介由配置於偏離畫線位置之間隔物傳遞。因此,產生切割不良之情況多,於後續製程產生玻璃缺損或玻璃碎片,良品率降低。

再者,於液晶顯示裝置,陣列基板多爲在周邊領域配置多數驅動電路,特別是,於畫線周邊部,配置較多之配線圖型。於此種配線圖型上配置間隔物時,該間隔物時。以前上之間隔物,僅高出配線圖型之間隔物。因此,衝擊器施加之衝擊,無法均一傳至所有發生別都不良之同時,因施加之衝擊有可能破壞配線圖型,成爲良品率降低之原因。

如上述,於遠離畫線之位置以較疏密度配置間隔物之構造中,對玻璃基板切割時,因間隔物之配置位置,衝擊位置相對於畫線之變動,及間隔物與配線圖型間之相對位置等之影響,而產生切割不良,於後續製程,容易發生玻璃缺損或玻璃碎片,良品率降低等問題。

### 〔發明之概要〕

本發明係爲解決上述問題點,目的在於提供一種可防止切割不良,可防止因玻璃缺損或玻璃碎片產生所導致良品率降低的液晶顯示裝置及液晶顯示裝置之製造方法。

本發明之液晶顯示裝置之製造方法,係使第1基板及第2基板對向配置,

A7 第0.123/. 前充。

### 五、發明説明(4)

藉由密封材將於上述第 1 基板與第 2 基板之間封入液晶材料用之特定領域予以包圍,據以使上述 2 片基板貼合

於上述密封材所包圍特定領域之外側領域,令上述 2 片基板之中至少一側沿切割線切割成特定尺寸的液晶顯示 裝置之製造方法;其特徵爲:

於上述切割線上配置用於保持上述2片基板間之間隙的間隔物。

### [ 較佳實施例之說明]

以下,參照圖面說明本發明之液晶顯示裝置及該液晶顯示裝置之製造方法之實施形態。

本發明之一實施形態之液晶顯示裝置,爲例如具備對 角 1 4 吋之顯示領域之主動矩陣型液晶顯示裝置,具如圖 1 所示之液晶顯示面板 1 0。

液晶顯示面板 1 0 ,如圖 1 所示,具有 3 第 1 基板之障列基板 1 0 0 ,及與 陣列基板 1 0 0 對向配置之第 2 基板之對向基板 2 0 0 ,及配置於陣列基板 1 0 0 與對向基板 2 0 0之間的液晶材料。液晶顯示面板 1 0 ,係具有:畫像顯示用之第 1 領域即顯示領域 1 0 2 ,及具連接驅動電路用之配線焊墊的第 2 領域即周邊領域 1 0 4 X,

1047。顯示領域102,係由形成於將陣列基板

100與對向基板200貼合、以密封材106包圍之領域內,周邊領域104X,104Y,係形成於密封材

### 五、發明説明(5)

106之外側領域。

陣列基板100之顯示領域102,如圖2及圖3所示,係於絕緣性基板,例如厚0、7mm之玻璃基板
101上互呈正交般配設1024×3條之信號線103,及768條掃描線111。掃描線111係由A1,Mo,W等低電阻材料形成,同時,直接配設於玻璃基板101上。信號線103,係由A1等低電阻材料形成之同時,配設於玻璃基板101上所形成氧化矽及氮化矽之多層膜所形成閘極絕緣膜113上。

文,陣列基板 1 0 0,係具有配設於各信號線 1 0 3 與各掃描線 1 1 1 之各交點部附近之作爲開關元件的薄膜電晶體即 T F T 1 2 1。又,陣列基板 1 0 0,係具有介由 T F T 1 2 1接於信號線 1 0 3之畫素電極 1 5 1。畫素電極 1 5 1,係由透過性導電性構件,例如 I T O 形成

TFT121,如圖2及圖3所示,以從掃描線
111延伸出之部分作爲閘極112。非晶質矽膜即 a 一Si:H膜形成之半導體膜115,係介由閘極絕緣膜
113配置於閘極112上。氮化矽形成之通道保護膜
117,係積層於半導體膜115上。

TFT121之源極131,係介由n<sup>+</sup>型非晶質矽膜即n<sup>+</sup>a-Si H膜形成之低電阻半導體膜119,電連接於半導體膜115及畫素電極151。TFT121之
汲極132,係與信號線103一體形成。汲極132,

### 五、發明説明(6)

係介由低電阻半導體膜 1 1 9 ,電連接於半導體膜 1 1 5 及信號線 1 0 3 。 T F T 1 2 1 之通道保護膜 1 1 7 ,源極 1 3 1 ,及汲極 1 3 2 係由氮化矽膜等絕緣膜構成之保證膜 1 7 1 被覆。

又,陣列基板 1 0 0 之表面,係由介於對向基板 2 0 0 之間使液晶組成物 3 0 0 配向之配向膜 1 4 1 被覆

於陣列基板100配置對向基板200時,對向基板200之顯示領域102,係於透明之絕緣性基板,例如厚0、7mm之玻璃基板201上具備遮光膜202。該 進光膜202,用於遮斷與陣列基板100上之配線圖型對向之領域。遮光膜202,係分別和陣列基板100之下下了121與信號線103之間隙,畫素電極151與掃描線111之間除等領域呈對向。遮光膜202係由例如Cr膜或樹脂層形成。

又,對向基板200,爲使從陣列基板100側透過對向基板200側之光束著色,於與陣列基板100之畫素電極151星對向之領域上具有濾色片203R,

203G,203B。即,對向基板200,係於各畫素 具可著色紅(R),綠(G),藍(B)3原色之濾色片 203R,203G,203G。

又,對向基板 2 0 0 具由 I T O 形成之對向電極 2 0 4 , 俾被覆滤色片 2 0 3 R , 2 0 3 G , 2 0 3 B 之 五、發明説明(7)

表面全面。

又,對向基板 2 0 0 之表面,係由介於陣列基板 1 0 0 之間使液晶組成物 3 0 0 配向之配向膜所被覆。

液晶顯示面板 1 0 之表背面,即玻璃基板 1 0 1 及玻璃基板 2 0 1 之外面,配設有偏光方向互呈正交之偏光板(未圖示)。

該間隔物210,係如下形成。

即,於對向基板 2 0 0 旋轉塗布感光性黑色樹脂後乾燥之。之後,對該感光性樹脂,介由特定圖型形狀即與陣列基板 1 0 0 配線圖型對應之形狀之光罩進行曝光,顯像。之後,藉燒結處理,形成用以遮斷與配線圖型對應之領域的遮光膜 2 0 2。

接著,令分散有綠色顏料之紫外線硬化型丙烯基樹脂 旋轉塗布於對向基板200之全面後乾燥之。之後,在與 綠色畫素領域,及黑色遮光膜202上之掃描線111對 向之領域,介由分別對應之形狀之光罩進行曝光,顯像。 之後,燒結處理以形成絕色濾色片203G。

### 五、發明説明(8)

接著,於與藍畫素領域,掃描線 1 1 1 對向之領域所積層之綠色濾色片 2 0 3 G上,與綠色濾色片 2 0 3 G同樣形成藍色濾色片 2 0 3 B。

之後,於與紅畫素領域,及掃描線111對向之領域所積層之藍色濾色片203B上,與綠色濾色片203G同樣地形成紅色濾色片203R。

如上述,於液晶顯示面板10之顯示領域102內,利用形成遮光膜202及濾色片203(G,B,R)之光蝕刻工程,於與掃描線111對向之部分依序積層黑色遮光膜202,及濾色片203G,203B,203R,形成柱狀之間隔物210。該間隔物210之遮光膜202及綠濾色片203G,如圖3所示,係與掃描線111平行積層。藍濾色片203B,則於掃描線111之配線方向,以特定寬,且以特定間隔積層於綠濾色片203B产。紅濾色片203R,係以較藍濾色片203B产。

又,此實施形態中,係於與掃描線111對向之位置形成間隔物210,但亦可形成於其他配線例如信號線

- 103之對向位置。又,此實施形態中,配線間隔物
- 2 1 0 之間隔爲約 5 0 m m ,係依液晶顯示裝置之顯示領域 1 0 2 之尺寸,間隔物 2 1 0 之尺寸等被最適化。

另一方面,於液晶顯示面板10之周邊領域104X

### 五、發明説明(g)

,綠,藍之各濾色片 2 0 3 ( R , G , B ) ,據以形成間隔物 2 1 0。圖 4 所示爲從與掃描線 1 1 1 之配線方向呈正交之方向看間隔物 2 1 0之斷面圖。如圖 4 所示,間隔物 2 1 0,係形成較積層之上層之寬爲小。據此則可容許積層遮光膜 2 0 2 及濾色片 2 0 3 ( R , G , B ) 時之位置偏移。

周邊領域104X,104Y所設間隔物210,係 利用顯示領域102中之對向基板200之遮光膜形成工程,及濾色片形成工程而形成。因此,於周邊領域104X,104Y形成間隔物210用之其他製程則不必要,可於對向基板形成時同時形成。

此液晶顯示面板 1 0 ,如圖 1 所示,爲使液晶顯示裝置之外形尺寸,特別是外框尺寸縮小,顯示領域 1 0 2 內配設之信號線 1 0 3 ,係僅引出於陣列基板 1 0 0 之周邊領域 1 0 4 C 之第 1 端邊 1 0 0 X 側。周邊領域 1 0 4 X 係具有配線焊墊用以電連接。信號線 1 0 3 ,及供給特定信號於該等信號線 1 0 3 之驅動電路。該配線焊墊,係於第 1 端邊 1 0 0 X 側,介由異方性導電接著劑連接於供給影像資料至信號線 1 0 3 之驅動電路,即 X - T A B

4 0 1 - 1 , 4 0 1 - 2 , 4 0 1 - 3 , 4 0 1 - 4 。該 周邊領域1 0 4 X 之寬,即密封材1 0 6 之外端起第 1 端 邊1 0 0 X 止之寬爲約3、2 m m。

又,配設於顯示領域 1 0 2 內之掃描線 1 1 1 ,係僅引出至與陣列基板 1 0 0 之周邊領域 1 0 0 Y 之第 1 端邊

### 五、發明説明(10)

100X正交之第2端邊100Y側。周邊領域104Y 具有配線焊墊用於電連接該掃描線111,及供給特定信號於該掃描線111之驅動電路。該配線焊墊,於第2端邊100Y側,係介由異方性導電接著劑連接於供給掃描線脈衝至掃描線111之驅動電路即Y-TAB 411 ,411-2。周邊領域104Y之寬,即密封材106 之外端起至第2端邊100Y止之寬爲約3、5mm。

X-TAB 401-1,401-2,401-3,401-4,係介由異方性導電接著劑連接於,向液晶顯示面板10之背面側折曲,用於控制液晶顯示面板10之背面所配置。各X-TAB 401-1,401-2,401-3,401-4的控制電路基板421。

又, Y - T A B 4 1 1 - 1 , 4 1 1 - 2 , 係介由 異方性導電接著劑連接於,配置於液晶顯示面板 1 0 之側 方,用以控制各 Y - T A B 4 1 1 - 1 , 4 1 1 - 2 的 控制電路基板 4 3 1 。

又,各X-TAB 401-1,401-2, 401-3,401-4與X控制電路基板421,或各Y-TAB 411-1,411-2與Y控制電路基板431之電連接,亦可由焊接來進行。

圖 4 之間隔物 2 1 0 係配置於,當對向基板與陣列基板呈對向配置時可避開陣列基板之周邊領域 1 0 4 X ,

104 Y 所形成之各種配線。

圖 5 爲 2 個液晶顯示面板 1 0 切斷之陣列基板用母玻

### 五、發明説明(11)

璃及對向基板用母玻璃以密封材貼合而成之格 C 之平面圖。陣列基板用母玻璃 1 0 0 M, 及對向基板用母玻璃 2 0 0 M, 具略同一尺寸。

為從陣列基板用母玻璃100M,及對向基板用母玻璃200M,切割出特定尺寸之液晶顯示面板10,需於母玻璃表面畫出切割線,以形成沿該切割線之裂痕(即靈線)。

於陣列基板用母玻璃100M形成與信號線之配線方向平行之第1及第2畫線ASL-1及ASL-2,及與掃描線之配線方向平行之第3~第6畫線ASL-3~ ASL-6。於對向基板用母玻璃200M形成平行於信號線之配線方向之第1及第2畫線CSL-1及CSL-2,及平行於掃描線配線方向之第3~第6畫線。

之後,由對向基板用母玻璃 2 0 0 M 侧沿陣列基板用母玻璃 1 0 0 M 上所形成畫線施加衝擊,使產生裂痕以切斷陣列基板用母玻璃 1 0 0 M 。由陣列基板用母玻璃 1 0 0 M 侧沿對向基板用母玻璃 2 0 0 M 上形成之畫線施

加衝擊,使產生裂痕以切斷對向基板用母玻璃200M。

圖 6 爲 母玻璃沿第 1 畫線 A S L - 1 之 C - D 線 切斷之斷面圖。即,於陣列基板用母玻璃 1 0 0 M 之第 1 畫線 A S L - 1 上,以約 5 0 μ m 之等間隔積層遮光膜 2 0 2,及濾色片 2 0 3 ( R, G, B ) 以形成間隔物。

同樣地,形成於陣列基板用母玻璃 1 0 0 M 之其他畫線,即第 2 ~第 6 畫線 A S L - 2 ~ A S L - 6 上,於對

### 五、發明説明(12)

向基板用母玻璃200M接觸有以特定節矩形成之間隔物210。但是,亦可不必在陣列基板用母玻璃所形成之所有畫線上接觸有間隔物。亦即,由母玻璃切出液晶顯示面板10時,只需配置成至少在相當於界定周邊領域 104X,104Y之框緣部分之畫線ASL-1, ASL-3,ASL-5上接觸有間隔物210即可。

該間隔物210,如上述般,係由沿畫線上,於對向基板用母玻璃200M上一直線配置之遮光膜202,於避光膜202上一直線積層之綠濾色片203G,於綠濾色片203G上島狀積層之藍濾色片203B,及於藍濾色片203B上島狀積層之紅濾色片203R所構成。

圖7A爲母玻璃沿第2畫線ASL-2之E-F線切

断之断面圖。亦即,於陣列基板用母玻璃 1 0 0 M之第 2 畫線 S A L - 2 上,和圖 6 之場合同樣地,以約 5 0 µ m 節矩接觸有間隔物 2 1 0。第 2 畫線 A S L - 2 上之密封材 1 0 6 所界定之注入口 1 0 8 附近,未配置間隔物 2 1 0。因此,沿陣列基板用母玻璃 1 0 0 M 之第 2 畫線 A S L - 2 切出陣列基板用母玻璃 1 0 0 M 之第 2 畫線 A S L - 2 切出陣列基板時,沿對向基板用母玻璃 2 0 0 M 之第 2 畫線 C S L - 2 切出對向基板後,在注入口 1 0 8 附近殘留間隔物斷片之不良現象不會產生。因此,從注入口 1 0 8 注入液晶材料時,可防止殘留之間隔物斷

又,注入口108,係沿第2畫線ASL-2具約 100mm之寬。因此,於注入口,爲確保陣列基板用母

片混入液晶材料之不良現象之發生。

### 五、發明説明(13)

玻璃 1 0 0 M 與對向基板用母玻璃 2 0 0 M 間之間隔,如圖 7 所示,平行於第 2 畫線 A S L - 2 隔特定間隔配置間隔物 2 1 0。該間隔物 2 1 0,與畫線上殘留之間隔物斷片不同,係確實固定於對向基板用母玻璃 2 0 0 M。因此,由注入口 1 0 8 注入液晶材料時,間綴物 2 1 0 混入液晶材料之可能性極低。

另一方面,圖 7 B 為,於陣列基板用母玻璃 1 0 0 M
所形成第 2 ,第 4 及第 6 畫線 A S L — 2 , A S L — 4 ,
A S L — 6 上,未配置間隔物 2 1 0 時之第 2 畫線 A S L
— 2 中之注入口 1 0 8 附近之擴大圖。如圖 7 B 所示,陣列基板用母玻璃 1 0 0 M 之第 2 畫線 A S L — 2 上,未配置間隔物 2 1 0。當然,第 2 畫線 A S L — 2 上之注入口 1 0 8 附近亦未配置間隔物。因此,注入口 1 0 8 附近務 留間隔物斷片之現象不會發生。因此,從注入口 1 0 8 注入液晶材料時,可防止殘留間隔物之斷片混入液晶材料等不良情況發生。

又,於注入口108,和上述同樣,與第2畫線 ASL-2平行地隔開特定間隔配置有間隔物。因此,由 注入口108注入液晶材料時,間隔物210混入液晶材料之可能性極低。

圖 8 為母玻璃沿與第 1 及第 2 畫線 A S L - 1 及
A S L - 2 星正交之 G - H 線切斷之斷面圖。又,圖 8 為間隔物 2 1 0 之構造之簡略圖。例如圖 8 所示之周邊領域 1 0 4 Y ,係具有接觸於陣列基板用母玻璃 1 0 0 M 之第

### 五、發明説明(14)

1 畫線ASL-1上之間隔物210。

第1畫線ASL-1起至密封材106止之間隔D153mm以上。又,第1畫線ASL起至密封材106止之間之領域之中,至少第1畫線ASL-1提3mm以內之領域內未設置間隔物210作第1畫線ASL-1提至與其最近配置之間隔物210止之間隔D253mm以上

又,畫線起3mm以內之領域,亦可配置間隔物。但 ,此領域內較好以較畫線上爲疏之配置密度配置間隔物。 此乃如後述,因沿畫線施加衝擊時,衝擊將沿畫線上集中 之故。

又,如圖 8 所示,於顯示領域 1 0 2 內,以特定間隔配置同樣之間隔物 2 1 0。顯示領域 1 0 2 內之間隔物係以 1 0 個/m m 2 左右之配置密度全體均一地配置。

另一方面,於第2畫線ASL-2上,接觸有間隔物210。該間隔物210係配置於接近密封材106之位置。

圖 9 爲 第 1 畫 線 周 邊 之 擴 大 圖。

以第 1 畫線 A S L - 1 爲中心之特定寬 D 3 ,例如 1 m m 寬之範圍內之領域作爲切出領域。即,該切出領域係包含間隔物 2 1 0 所接觸之畫線上,及畫線近傍之領域。如圖 9 所示,配置於切出領域內之間隔物 2 1 0 ,係沿第1 畫線 A S L - 1 以略等間隔設成直線狀。又,此例中,第1 畫線 A S L - 1 起 3 m m 以內之領域內未配置間隔物

### 五、發明説明(15)

- 。配置於切出領域內之間隔物210具有一邊爲20~
- 5 0 μ m 之寬W。

以下,說明此液晶顯示裝置之製造方法。

首先,準備陣列基板用母玻璃100M及對向基板用母玻璃200M。陣列基板用母玻璃100M,如圖3所示,係具有:沿透明玻璃基板101上之行方向平行之多數掃描線111,及沿列方向平行之多數信號線103,及畫素數分之畫素電極151,及畫素數分之

TFT121。對向基板用母玻璃200M,如圖3所示,係具有:透明玻璃基板201上之遮光膜202,及濾色片203(R,G,B),及對向電極204,及藉由積層遮光膜及濾色片分別於顯示領域102及周邊領域

1 ( X , Y ) 以特定配置密度形成的間隔物 2 1 0。

接著,洗淨陣列基板用母玻璃 1 0 0 M 及對向基板用母玻璃 2 0 0 M 之後,於各母玻璃之顯示領域 1 0 2 內塗布聚醯亞胺膜,益燒結之。之後,對該聚醯亞胺膜施予摩擦處理使成特定方向,以形成配向膜 1 4 1 , 2 0 5。

之後,再度洗淨後,如圖 5 所示,於陣列基板用母玻璃 1 0 0 M或對向基板用母玻璃 2 0 0 M塗布密封材 1 0 6 ,將 2 片母玻璃貼合以形成格。此時,於後續工程,於陣列基板用母玻璃 1 0 0 M所形成畫線上,使對向基板用母玻璃 2 0 0 M上所形成間隔物 2 1 0 呈接觸般予以貼合。之後,使密封材 1 0 6 硬化。在塗布密封材 1 0 6

時,藉密封材106形成於後續工程注入液晶材料用之注

五、發明説明(16)

入口108。

接著,將陣列基板用母玻璃100M及對向基板用母玻璃200M切成所要尺寸。此切割工程之詳細如後述。

接著,於母玻璃切出之液晶顯示面板10之2片基板間,由注入口注入液晶材料,以密封材封入液晶材料。

之後,於陣列基板100之表面及對向基板200之表面安裝偏光板。

如圖1所示,在陣列基板100之周邊領域104(X,Y)所形成配線焊墊安裝驅動電路401-1~

4 0 1 - 4 , 4 1 1 - 1 ~ 4 1 1 - 2 .

之後,於液晶顯示面板10之背面,即陣列基板

100侧安裝背照燈以完成液晶顯示裝置。

以下,詳細說明液晶顯示裝置之製程中之切割工程。

圖10A~圖10F為對圖5之母玻璃切割之切割工程之說明圖。以下,以沿圖5之G-H線切割之斷面圖說明之。

如圖10A所示,首先,準備以密封材106貼合陣列基板用母玻璃100M及對向基板用母玻璃200M而成之格C。

如圖 1 0 B 所示 · 於陣列基板用母玻璃 1 0 0 M 之表面形成畫線 · 即如圖 5 所示 · 形成與信號線配線方向平行之第 1 及第 2 畫線 A S L - 2 , 及與掃描線配線方向平行之第 3 ~第 6 畫線 A S L - 3 ~ A S L - 6。於圖 1 0 B 圖示出第 1 及第 2 畫線 A S L - 1 及 A S L

### 五、發明説明(17)

- 2 · 之後 · 令格 C · 以陣列基板用母玻璃 1 0 0 M 朝下載置於工作台上。

接著,如圖 1 0 C 所示,由格 C 之對向基板用母玻璃 2 0 0 M 侧,沿畫線施加均一之衝擊。該均一之衝擊,係指以稱爲衝擊器之向一方向延伸之橡膠製棒狀構件沿畫線打 懸以施加力量。

該衝擊,將介由接觸於畫線上之間隔物210,即設於對向基板用母玻璃200M之間隔物,傳至陣列基板用母玻璃100M側。藉此種衝擊,使於間隔物200側進行形成有畫線之裂痕。

同樣,沿全畫線施加衝擊,以進行形成裂痕。

之後,如圖 1 0 D 所,於對向基板用母玻璃 1 0 0 M 之表面形成畫線。即,如圖 5 所示,形成與信號線配向方向平行之第 1 及第 2 畫線 C S L - 1 及 C S L - 2 ,及與掃描線配線方向平行之第 3 ~ 第 6 畫線 C S L - 3 ~

C S L - 6。於圖 1 0 D 示出第 1 及第 2 畫線 C S L - 1 及 C S L - 2。之後,令格 C ,以對向基板用母玻璃

2 0 0 M 朝下載置於工作台上。

接著,如圖10 E所示,由格 C 之陣列基板用母玻璃100 M側,沿畫線施加均一之衝擊。沿第1畫線 C S L — 1 施加之衝擊,係介由接近第1畫線 C S L — 1 配置之密封材106 傳至對向基板用母玻璃200 M側。又,沿第2畫線 C S L — 2 施加之衝擊,係介由接觸於第2畫線 C S L — 2 上之間隔物210,傳至對向基板用母玻璃

### 五、發明説明(18)

200 M 側。藉由該衝擊來進行形成有畫線之裂痕。

同樣地,沿全畫線施加衝擊,以進行裂痕之形成。

如上述般於陣列基板用母玻璃 1 0 0 M 及對向基板用母玻璃 2 0 0 M 上所形成金畫線進行形成裂痕,據以切割成圖 1 0 F 所示液晶顯示面板 1 0。

此時,如圖10F所示,於密封材106之外側領域,間隔物210之一部分會殘留,但是,如使用圖7說明般,於注入口108末配鑑間隔物210,故殘留間隔物210之一部分不致對液晶顯示裝置本身有不良影響。

又,由母玻璃切出液晶顯示面板 1 0 之順序,並不限 定於上述例。

如上述般,例如切割陣列基板 1 0 0 時,由對向基板用母玻璃 2 0 0 M 侧施加之衝擊,係介由於畫線上以等間隔,且以較遠離畫線周邊之領域及高之配置密度接觸之間隔物 2 1 0 ,傳至陣列基板用母玻璃 1 0 0 M。因此,形成畫線之裂痕,係以相對基板主面略垂直方向進行,可防止切割不良之產生。

因此,於後續之液晶注入工程或偏光板貼合工程,可抑制玻璃缺損或玻璃碎片等不良之產生,可提高良品率。

以下,於上述液晶顯示裝置之製造方法,改變間隔物之配置位置之情況下,比較切割液晶顯示面板時所產生之切割不良結果。

即,實驗條件A爲,針對從畫線外側,即從密封材側偏離O.3mm之位置,與畫線平行地以略等間隔配置有

### 五、發明説明(19)

間隔物之格進行切割之場合。實驗條件B爲,針對從畫線SL起內側,即與近接於密封材之側偏離 0 . 3 m m 之位置,與畫線平行地以略等間隔配置有間隔物之格進行切割之場合。實驗條件C,如圖 9 所示,爲針對沿畫線上之切出領域以略等間隔且直線配置間隔物之格進行切割之場合

實驗條件A,B,C均實驗6次,相對於畫線,衝擊器打擊位置之偏差,以畫線上爲基準時,爲土1 mm。

此處, "一"表示相對畫線偏離密封材側之場合, " +"表示相對畫線由密封材偏離外側之場合。

此3實驗條件之各別實驗結果如圖11所示。此處,切割格時,切割不良產生時,裂痕爲由畫線起相對玻璃面斜向進行,玻璃基板之切割斷面相對於玻璃基板主面不呈垂直狀,形成銳利之斷面形狀。爲使切割不良定量化,以從畫線位置起,至切割斷面中之最遠離畫線部分止之長數份割不良量。切割不良量爲"一"時表示相對於畫線斷面形狀形成偏向密封材之外側。

如圖 1 1 所示,實驗條件 A 中之切割不良量之平均值 爲 ± 0 、1 m m ,以標準偏差爲α時,3 σ 値爲 0 、3 4 。即,於實驗條件 A ,以 — 0 。 2 4 m m ~

+0.44mm之偏差量產生切割不良之可能性。

實驗條件B中之切割不良量之平均值爲

- 0 、 1 1 m m , 3 σ 值 爲 0 、 4 4 。 即 , 於 實 驗 條 件 B

### 五、發明説明(20)

,以一0、55mm~+0.33mm之偏差量產生切割不良之可能性。

實驗條件 C 中之切割不良量之平均值爲 0 、 0 1 m m , 3 σ 值爲 0 、 0 4 。即,於實驗條件 C ,

一 0 . 0 3 m m ~ + 0 . 0 5 m m 之偏差量產生切割不良 之可能性。比較上述實驗條件 A 及 B 可知,切割不良量極 小,偏差量亦小。

由此實驗結果可知,於畫線上均一配置間隔物,可抑制切割不良之產生。又,即使產生切割不良,該切割不良量亦爲不致影響後續工程之極微量。因此,可抑制切割不良之產生,提昇良品率。

以下,針對實驗條件 C 使用之液晶顯示面板,即圖 9 所示於畫線上以等間隔且直線地配置有間隔物之液晶顯示面板進行切割時之相對於衝擊器之打擊位置之偏差所產生切割不良量之大小加以測定。即,由畫線上以衝擊器衝擊時,針對畫線偏離土1、5 m m 位置之衝擊之場合,及相對畫線偏離土2、0 m m 位置之衝擊之場合,分別施予多次之重複實驗,並測定各個切割不良量。測定結果如圖 1 2 所示。

如圖 1 2 所示,於此液晶顯示面板中,相對於畫線最大偏離 2 m m 時之以衝擊器衝擊時,切割不良量亦可抑制於大概 1 0 0 μ m 以下。

如上述般,玻璃基板切割時,於畫線周邊之切割領域

訂

### 五、發明説明(21)

,以等間隔,直線配置間隔物,如此則形成有畫線之衝擊可以相對基板主面略垂直方向進行,可防止切割不良之產生。又,即使衝擊器之打擊位置之偏差,亦不會有較大切割不良之產生,可抑制玻璃缺損或玻璃碎片之不良之產生,提昇良品率。

於上述實施形態中,如圖 9 所示,係將間隔物配置於畫線正下方,但於畫線正下方無法配置間隔物時,可以畫線爲對稱軸,使畫線兩側對稱地,且以等配置密度配置間隔物。此場合下,衝擊器之衝擊,係介由配置於畫線兩側之間隔物,沿畫線均等傳遞,故和直線地配置於畫線正下方之場合可得相同之效果,可防止切割不良。

以下,說明本發明其他實施形態。

此實施形態中,於格 C 之間邊領域 1 0 4 ,間隔物 2 1 0 係如圖 1 3 所示,以較顯示領域 1 0 2 內之間隔物 2 1 0 爲密之配置密度被配置。特別是如圖 1 4 所示,陣列基板用母玻璃 1 0 0 M上所形成畫線上及由該畫線起 3 mm以內之領域,間隔物 2 1 0 以較密且均一地配置。該領域中之間隔物 2 1 0 之配置密度爲例如 1 2 個 / mm²~1 0 0 個 / mm²以上,較好爲 1 5 個 / mm²以上。另一方面,於液晶顯示面板 1 0 之顯示領域 1 0 2 內,間隔物 2 1 0 係以 1 0 個 / mm²之配置密度均一地配置。

於上述構造之格中,例如對陣列基板用母玻璃 100m切割時,由對向基板用母玻璃200m側施加之 衝變,係介由沿畫線周邊均一且緊密配置之間隔物210

### 五、發明説明(22)

,傳遞至陣列基板用母玻璃 1 0 0 m。因此,形成有畫線之裂痕,係相對基板主面以略垂直方向進行,可防止切割不良之產生。

因此,於後續之液晶注入工程或偏光板貼合工程等,可抑制玻璃缺損或玻璃碎片等不良之產生,提昇良品率。

以下,針對上述液晶顯示裝置之製造方法中,改變間隔物之配置位置,並比較液晶顯示面板切割時產生之切割不良。

亦即,實驗條件A及B係和上述例相同。實驗條件D,如圖14所示,係針對在畫線周邊以15個/mm²配置密度分散配置間隔物之格進行切割之場合。

實驗條件 D,實驗次數爲 5 4 次,衝擊器對畫線之衝擊位置之偏差爲 - 0 , 2 m m ~ + 0 . 1 5 m m。

實驗條件 D 之實驗結果及上述實驗條件 A 及 B 之實驗結果均示於圖 1 5。

如圖 1 5 所示,實驗條件 D 之切割不良量之平均值爲 0 . 0 4 m m , 3 σ 值爲 0 . 0 9 。亦即,於實驗條件 D 係以一 0 . 0 5 m m ~ + 0 . 1 3 m m 之偏差存在有切割不良發生之可能性。但和上述實驗條件 A 及 B 比較,切割不良量極小,偏差量亦極小。

由此實驗結果可知,藉由在畫線周邊部均一分散配置間隔物,可抑制切割不良之產生。又,即使切割不良產生時,切割不良量亦爲不致影響後續工程之極小量。因此,可抑制切割不良之產生,提昇良品率。

### 五、發明説明(23)

如上述,對玻璃基板進行切割時,於畫線周邊,以 12個/mm²以上,較好爲15個/mm²以上之密度均一配置間隔物,則形成畫線之衝擊係以對基板主面略垂直之方向進行,可防止切割不良之產生。又,即使衝擊器之衝擊位置有偏差,亦不致產生較大之切割不良,可抑制玻璃缺損或玻璃碎片等不良之產生,提昇良品率。

本發明並不限定於上述實施形態,可作各種變形。例如,間隔物不藉由積層濾色片來形成亦可。亦即,使用單層樹脂,以一工程形成間隔物亦可。又,配置於畫線周邊部之間隔物,及其他部分之間隔物,其配靈方法,材質,大小,形狀等不必一定相同,亦不必以同一製程配置間隔物。

於上述實施形態中,間隔物相對於畫線形成爲島狀。但亦可配合畫線形成爲直線狀,較之島狀之場合可更提昇畫線精度。

又,於上述實施形態中,係以薄膜電晶體作爲開關元件適用於液晶顯示裝置之場合爲例作說明。但亦可適用於其他驅動方式之液晶顯示裝置。例如使用薄膜二極體即 TFD驅動之液晶顯示裝置,或基板本身不具開關元件之單純矩陣型液晶顯示裝置亦可適用。

又,上述實施形態中,係使用積層濾色片作爲間隔物,但亦可形成黑色樹脂或透明樹脂等單層。另外,藉由塑膠粒子等接著劑固定於基板亦可。

又,於上述實施形態中,係於對向基板上配置間隔物

### 五、發明説明(24)

。但亦可配置於陣列基板上。

如上述說明般,依本發明可提供一種可抑制切割不良之產生,防止玻璃缺損或玻璃碎片所導致良品率之下降的液晶顯示裝置及液晶顯示裝置之製造方法。

### [圖式之簡單說明]

圖 1 : 本 發 明 之 液 晶 顯 示 裝 置 適 用 之 液 晶 顯 示 面 板 之 一 例 之 槪 略 斜 視 圖 •

圖2:圖1之液晶顯示面板之顯示領域中之陣列基板之構造之概略平面圖。

圖3:圖2之陣列基板沿A-B線切斷時之斷面之概略斷面圖。

圖4:圖1之液晶顯示面板之周邊領域之構造之概略斷面圖。

圖 5 : 切割液晶顯示面板 1 0 之陣列基板用母玻璃及對向基板用母玻璃藉由密封材予以貼合而成格之平面圖。

圖 6 : 圖 5 之格沿 C - D 線切斷時之斷面之概略斷面圖。

圖 7 : 圖 5 之格沿 E - F 線 切斷 時 之 斷 面 之 概 略 斷 面

圖 8 : 圖 5 之格沿 G - H 線切斷時之斷面之概略斷面圖。

圖 9 : 圖 5 之格沿之陣列基板用母玻璃所形成之第 1 畫線周邊之構造之擴大圖。

### 五、發明説明(25)

圖 1 0 A ~ 圖 1 0 F : 由圖 5 之格切割出液晶顯示面板之工程之說明用斷面圖。

圖 1 1 : 變化間隔物之配置位置進行切割時之切割不良量之測定結果。

圖 1 2 : 變化衝 鑿器之衝擊位置進行切割時之切割不良量之測定結果。

圖 1 3 : 本 發 明 其 他 實 施 形 態 說 明 之 格 之 斷 面 圖。

圖 1 4 : 圖 1 3 之格之陣列基板用母玻璃上所形成第 1 畫線周邊之構造之擴大圖。

圖 1 5 : 圖 1 3 之格中,變化間隔物之配置位置進行切割時之切割不良量之測定結果。

### 〔符號說明〕

- 10 液晶顯示面板
- 100 陣列基板
- 100X 第1端邊(周邊領域104X)
- 100 Y 第2端邊(周邊領域104 Y)
- 100M 陣列基板用母玻璃
- 101 玻璃基板(陣列基板)
- 102 顯示領域(第1領域)
- 103 信號線
- 104X 周邊領域(第2領域)
- 104Y 周邊領域(第2領域)
- 106 密封材

```
經濟部中央標準局員工消費合作社印製
```

```
B7
五、發明説明(26)
  1 0 8
        注入口
  1 1 1
        掃描線
  1 1 2
        閘極
  1 1 3
        閘極絕緣膜
  1 1 5
        半導體膜
  1 1 7
        通道保護膜
  1 1 9
        低電阻半導體膜
        薄膜電晶懸(TFT)
  1 2 1
  1 3 1
        源極
  1 3 2
        汲 極
  1 4 1
        配向膜(陣列基板)
        畫素電極
  1 5 1
        保護膜
  1 7 1
  2 0 0
        對向基板
  200M 對向基板用母玻璃
        玻璃基板(對向基板)
  2 0 1
  2 0 2
        遮光膜
  2 0 3 R · G · B
                濾色片
  2 0 4
        對向電極
        配向膜(對向基板)
  2 0 5
  2 1 0 間隔物
  3 0 0
        液晶組成物
  4 0 1 - 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 X T A B ( Tape Automated
Bonding )
```

五、發明説明(27)

4 1 1 - 1 , 2 Y T A B ( Tape Automated Bonding )

421 X控制電路基板

4 3 1 Y控制電路基板

( 請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁 )

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

# 公告本品品品

80 7123 1 13 E

### 六、申請專利範圍

附件 1:

## 第 87113274 號 專 利 申 請 案 中 文 申 請 專 利 範 圍 修 正 本

民國 90 年 12 月修正

1 一種液晶顯示裝置之製造方法《係使第1基板及第2基板對向配置,

藉由密封材將於上述第 1 基板與第 2 基板之間封入液晶材料用之特定領域予以包圍,據以使上述 2 片基板貼合

於上述密封材所包圍特定領域之外側領域,令上述 2 片基板之中至少一側沿切割線切割成特定尺寸的液晶顯示裝置之製造方法;其特徵為:

在除了上述切割線之附近以外之大略於上述切割線上配置用於保持上述2片基板間之間隙的柱狀間隔物。

2 如申請專利範圍第1項之液晶顯示裝置之製造方法,其中

在除了從上述切割線起算離開大於 0 、 5 m m ,且從上述切割線起算 3 m m 以內之領域以外,配置柱狀間隔物

3 如申請專利範圍第1項之液晶顯示裝置之製造方法,其中

於上述切割線起算 3 m m 以內之領域以 1 2 個/m m <sup>2</sup>以上之密度配置柱狀間隔物。

4 如申請專利範圍第3項之液晶顯示裝置之製造方

### 六、申請專利範圍

法, 其中

於上述切割線起算 3 m m 以內之領域以 1 5 個/m m <sup>2</sup>以上之密度配置柱狀間隔物。

5 如申請專利範圍第1項之液晶顯示裝置之製造方法,其中

爲保持上述密封材所包圍上述特定領域之上述2片基板間之間隙,於上述特定領域內之特定位置,配置和上述柱狀間隔物以同一工程形成之柱狀間隔物。

6.如申請專利範圍第5項之液晶顯示裝置之製造方法,其中

上述特定領域,爲顯示多數之色成分,於包含各色成分對應之多數畫素領域之每一畫素領域,將各色成分之總色片配置於上述第2基板,同時,在除了切割線附近以外之大略於上述切割線上及上述特定領域內之特定位置,積層該多數色成分之纏色片以形成柱狀間隔物。

7 如申請專利範圍第1項之液晶顯示裝置之製造方法,其中

上述密封材,係爲確保將液晶材料注入於上述特定領域內用之注入口而設,除了包含該注入口之切割線上以外配置柱狀間隔物。

8 . 一種液晶顯示裝置之製造方法,係

使形成有具畫素圖型之第1領域,及該第1領域之周邊且具配線焊墊之第2領域的第1基板,及與上述第1領域對應且形成有電極的第2基板對向配置:

### 六、申請專利範圍

藉由區分上述第 1 領域與第 2 領域之密封材將上述 2 片基板貼合:

於上述第2領域,對上述2片基板沿切割線切割成特定尺寸之液。攝類示裝置之製造方法:其特徵爲:

在除了上述第1基板之第1切割線附近以外之大略於上述切割線上,保持上述2片基板間間隔之同時於與上述第2基板所設柱狀間隔物接觸之狀態下沿上述第1切割線對上述第1基板進行切割。

於上述第2基板之第2切割線上,以未接觸柱狀間隔物之狀態下沿上述第2切割線對上述第2基板進行切割。

9.如申請專利範圍第8項之液晶顯示裝置之製造方法,其中

在除了從上述第1切割線起算離開大於0.5mm, 且從上述切割線起算3mm以內之領域以外,使接觸柱狀間隔物。

10 如申請專利範圍第9項之液晶顯示裝置之製造方法,其中

從上述第 1 切割線起算離開大於 0 . 5 m m 之領域,且從上述切割線起算 3 m m 以內之領域內,爲上述第 2 切割線之位置。

11、如申請專利範圍第8項之液晶顯示裝置之製造方法,其中

上述第 1 領域爲顯示多數色成分之顯示領域,於包含各色成分所對應多數畫素領域之每一畫素領域內,將各色

### 六、申請專利範圍

成分之濾色片配置於上述第2基板,同時,在除了上述第1切割線附近以外之大略於上述切割線上及上述顯示領域內之特定位置,積層該多數色成分之濾色片以形成柱狀間隔物。

12.一種液晶顯示裝置,係具有:

第1基板,其具有:包含畫素電極及驅動該畫素電極之開關元件的第1領域;及位於該第1領域之周邊之同時,包含有連接於上述開關元件之配線焊墊的第2領域;

第2基板,係與上述述第1基板呈對向配置之同時,於對向於上述第1領域之位置具有電極;

間隔物,係形成於上述第2基板上之同時,於上述第1領域及第2領域保持上述第1及第2基板之間於一定間除;及

密封於上述第1基板與第2基板間的液晶材料;其特徵爲:

沿切割成特定尺寸之第 1 及第 2 基板之外周緣,至少一部分配置有柱狀間隔物。

13.一種液晶顯示裝置之製造方法,係令第1基板與第2基板對向配置;

於上述第1基板與上述第2基板之間藉由包圍封入液晶材料用之特定領域的密封材,使上述2片基板貼合;

於上述密封材所包圍特定領域之外側領域,令上述 2 片基板之中至少 1 片沿切割線切割成特定尺寸的液晶顯示裝置之製造方法,其特徵爲

## 六、申請專利範圍

於上述第 1 基板或第 2 基板之任一片上,一體形成用於保持上述 2 片基板間之間隔的柱狀間隔物;

上述柱狀間隔物之一部分,係沿上述切割線以直線狀以略等間隔配電。

14、一種液晶顯示裝置之製造方法,係令

第1基板與第2基板對向配置;

於上述第 1 基板與上述第 2 基板之間藉由包圍封入液晶材料用之特定領域的密封材,使上述 2 片基板貼合

於上述密封材所包圍特定領域之外側領域,令上述 2 片基板之中至少 1 片沿切割線切割成特定尺寸的液晶顯示 裝置之製造方法,其特徵為

於上述第1基板或第2基板之任一片上,一體形成用於保持上述2片基板間之間隔的柱狀間隔物:

上述柱狀間隔物,係包含於上述切割線附近以第1配置密度配置的第1間隔物,及於其他領域以第2配置密度配置的第2間隔物。

15 如申請專利範圍第14項之液晶顯示裝置之製造方法,其中

上述柱狀間隔物係包含:沿上述切割線以第1配置密度配置的第1間隔物,及於上述切割線起算離開大於

0 . 5 m m 之領域,且於上述切割線起算 3 m m 以內之領域以較上述第 1 配置密度疎之密度配置的第 2 間隔物。

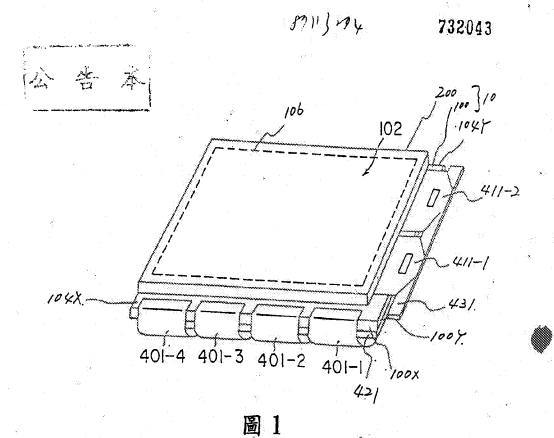
16、如申請專利範圍第14項之液晶顯示裝置之製造方法,其中

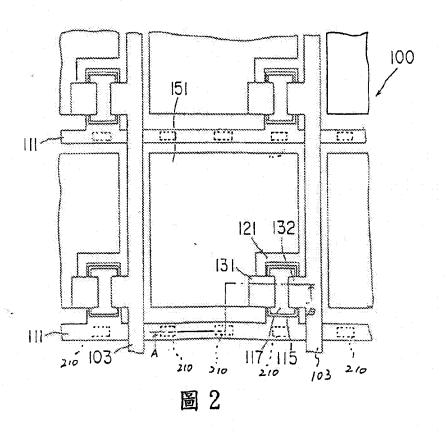
## 六、申請專利範圍

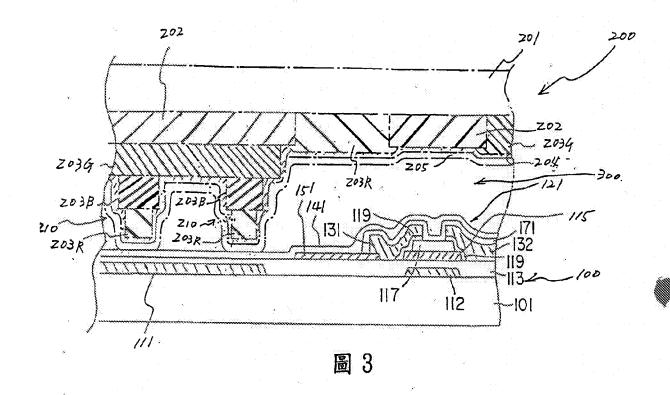
上述第2間隔物之配置密度爲12個/mm²以上。

17、如申請專利範圍第14項之液晶顯示裝置之製造方法,其中

上述第一2間隔物之配置密度爲15個/mm²以上。







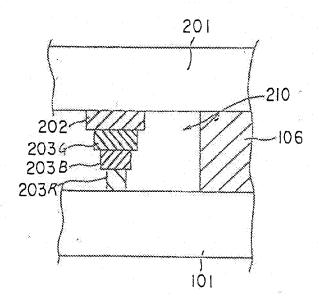
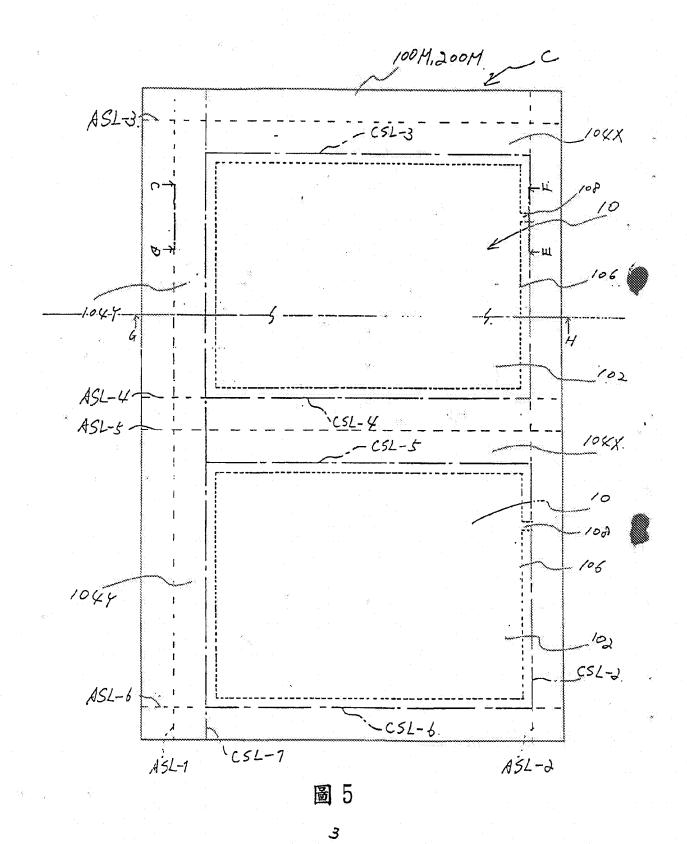
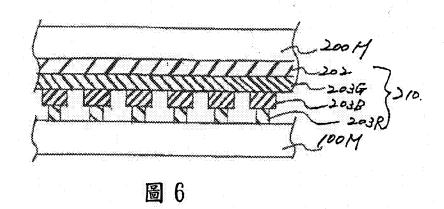
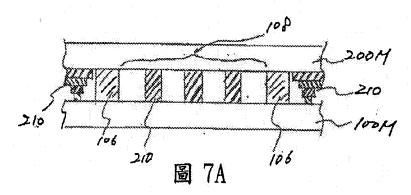


圖 4







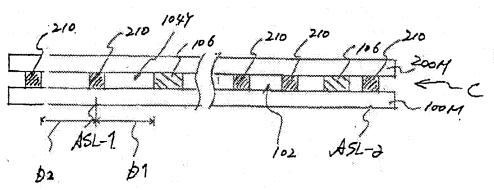


圖 8

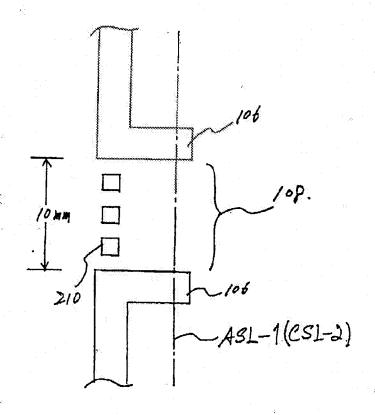
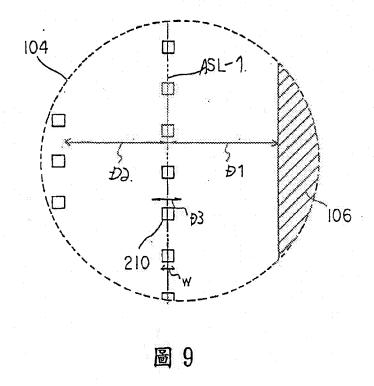
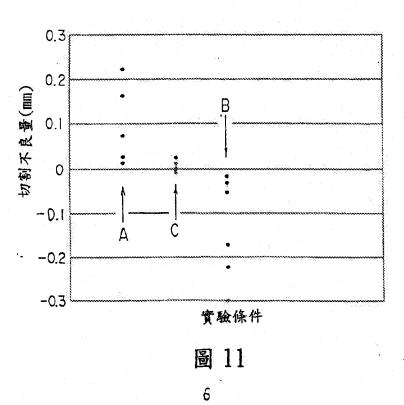
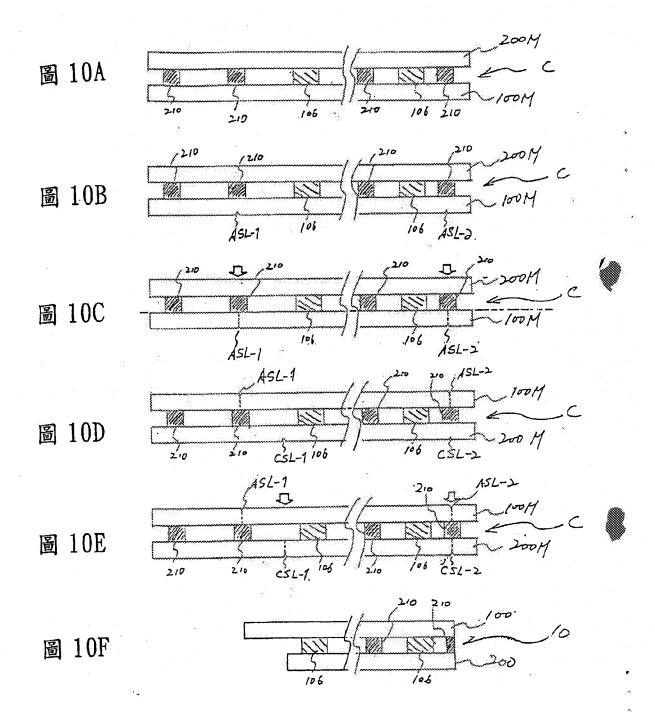


圖 7B







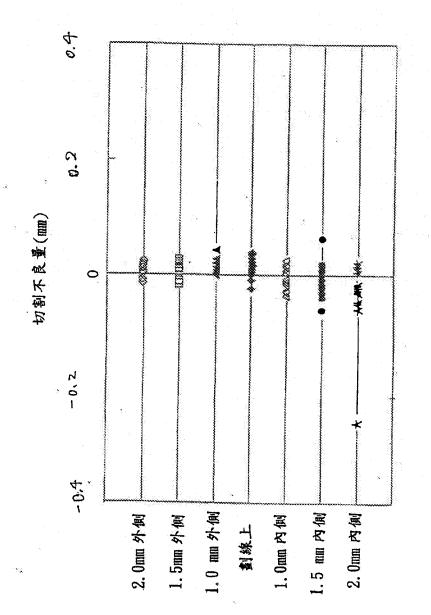


圖 12

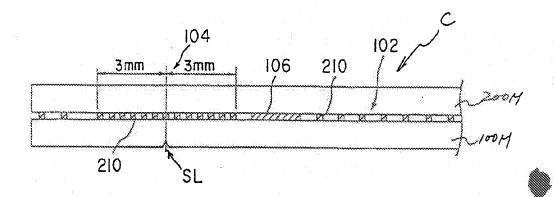
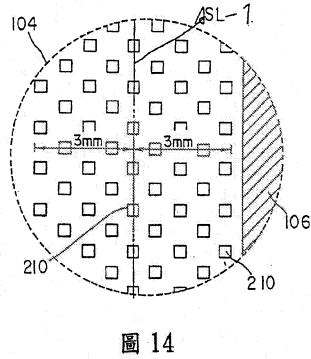


圖 13



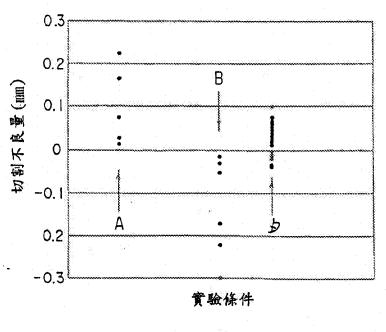


圖 15

## LCD device having pillar spacers in a cell gap receiving liquid crystal

(A) 62812180059L KRZ0030031842 (A) (1A) 926170E00SSU US7133110 (B2) se benzilduq ozlA

NEC LCD TECHNOLOGIES LTD (JP) SASAKI TAKESHI (JP); HANNUKI TAKAHISA (JP) 2003-10-01

Publication date:

Applicant:

Inventor:

- International: Classification:

G09F9/30; G09F9/35; G02F1//362; G02F1//3; GOSE1/1332! GOSE1/1333! GOSE1/1368! GO3E3/00!

G05F1/1339B - European: G09F9/00; G09F9/30; G09F9/35; (IPC1-7); G02F1/136

Publication number: TW5560358

Priority number(s): JP20010317593 20011016 Application number: TW20020122505 20020930

Report a data error here

## Abstract of TW556035B

organic overcoat. gate electrode exposed from an opening of an panel and abut the TFT panel at a portion of the The pillar spacers are formed on the color filter filter panel and the TFT panel of the LCD device. achleving a uniform cell gap between the color spacers disposed within liquid crystal for An LCD device includes a plurality of pillar